

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 1 区分
【発行日】平成 19 年 6 月 7 日 (2007.6.7)

【公開番号】特開 2002-75580 (P2002-75580A)
【公開日】平成 14 年 3 月 15 日 (2002.3.15)
【出願番号】特願 2000-267374 (P2000-267374)
【国際特許分類】

H 0 1 R 43/00 (2006.01)

H 0 1 B 13/00 (2006.01)

H 0 1 R 11/01 (2006.01)

【F I】

H 0 1 R 43/00 H

H 0 1 B 13/00 5 0 1 P

H 0 1 R 11/01 5 0 1 F

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 4 月 12 日 (2007.4.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 導電粒子が特定の領域にのみ配置されている異方導電フィルムの製造方法であって、
帯電している導電粒子に対して静電的な引力又は斥力を作用させ
基材上に導電粒子を集中して配置するための領域を形成する工程を有する
ことを特徴とする異方導電フィルムの製造方法。

【請求項 2】 更に、異なる基材上に導電粒子を転写する工程を有することを特徴とする請求項 1 記載の異方導電フィルムの製造方法。